

ICS 77.150.99
H 63

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1024—2015

溅射用钽靶材

Tantalum sputtering targets

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、西安方科新材料科技有限公司。

本标准主要起草人：钟景明、李桂鹏、汪凯、李兆博、姚力军、熊晓东、王莉、宿康宁、王小青、杜铁路。

溅射用钽靶材

1 范围

本标准规定了用以制备薄膜的溅射用钽靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于以真空电子束熔炼的高纯钽锭为原料,通过塑性加工、热处理、机械加工、焊接等方法制造的溅射用钽靶材(以下简称钽靶材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8651 金属板材超声板波探伤方法

GB/T 15076.8 钽铌化学分析方法 碳量和硫量的测定

GB/T 15076.13 钽铌化学分析方法 钽中氮量的测定

GB/T 15076.14 钽铌化学分析方法 氧量的测定

GB/T 15076.15 钽铌化学分析方法 氢量的测定

GB/T 20967—2007 无损检测 目视检测 总则

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 899 高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

3 要求

3.1 产品分类

钽靶材按纯度分为:3N5(99.95%)、4N(99.99%)、4N5(99.995%)三个级别。

3.2 化学成分

钽靶材的化学成分应符合表1的规定。